

第3【設備の状況】

1【設備投資等の概要】

当社グループ（当社及び連結子会社）では、新製品の研究開発、サービス提供能力の拡大、生産の効率化、品質の向上等を図るべく、設備の拡充、改良並びに更新を進めており、当連結会計年度におきましては、減価償却費の範囲内で成長分野に集中するとともに今後の事業展開に備えるため1,597億円の設備投資を行いました。

その主要なものとしたしましては、ソフトウェア・サービス関係では、お客様へ提供するサービスの向上とビジネスのスピードアップを図るため、東京/蒲田に新棟を建設し、富士通ソリューションスクエアとしたほか、アウトソーシング設備、企業向けネットワークサービス基盤設備を増強し、540億円を投資いたしました。

プラットフォーム関係では、TRIOLEコンセプトの中核となるUNIXサーバ及びLinuxサーバ等の基幹システム製品の開発設備、携帯電話、IPネットワークの開発・製造設備及びHDD（小型磁気ディスク装置）製造設備の増強等を行い、324億円を投資いたしました。

電子デバイス関係では、当社が注力する最先端ロジックIC開発・量産設備およびPDP（プラズマディスプレイパネル）の量産設備の増強等を行い、593億円を投資いたしました。

なお、設備投資額につきましては、上記セグメント以外の設備投資額並びに当社の一般管理部門及び共通部門等各セグメントに配賦できない設備投資額139億円が含まれております。

2【主要な設備の状況】

当社グループ（当社及び連結子会社）における主要な設備は、以下のとおりであります。

(1) ソフトウェア・サービス

平成16年3月31日現在

会社名及び事業所名 (所在地)	設備の内容	投下資本（百万円）					従業員数 (人)	
		土地 (面積千㎡)	建物 及び 構築物	機械装置	その他	合計		
提出会社	幕張システムラボラトリ (千葉市美浜区)	システム開発設備	3,708 (14)	12,235	51	1,226	17,221	1,167
	富士通ソリューションスクエア (東京都大田区) (注3.)	システム開発設備	0 (0)	2,495	2,517	4,318	9,331	4,647
	館林システムセンタ (群馬県館林市)	アウトソーシング設備	1,913 (126)	7,986	912	7,811	18,624	153
	関西システムラボラトリ (大阪市中央区)	システム開発設備	9,263 (13)	3,619	50	319	13,252	762
在外子会社	Fujitsu Services Holdings PLC (イギリス他) (注4.)	システム開発設備及びアウトソーシング設備	0 (0)	4,617	2,518	14,138	21,273	12,695

(2) プラットフォーム

平成16年3月31日現在

会社名及び事業所名 (所在地)		設備の内容	投下資本 (百万円)					従業員数 (人)
			土地 (面積千㎡)	建物 及び 構築物	機械装置	その他	合計	
提出会社	長野工場 (長野県長野市)	磁気ディスク 装置製造設備	920 (116)	7,677	4,368	1,113	14,080	464
	小山工場 (栃木県小山市)	光伝送システ ム製造設備	981 (184)	6,073	1,749	2,450	11,255	1,041
	那須工場 (栃木県大田原市)	移動通信シス テム製造設備	1,250 (184)	3,401	1,240	5,108	11,001	659
国内子 会社	㈱富士通ITプロダクツ本社 (石川県かほく市)	コンピュータ 製造設備	388 (129)	2,801	732	922	4,843	503
在外子 会社	Fujitsu Network Communications, Inc. リチャードソン工場 (米国テキサス州)	光伝送システ ム製造設備	3,073 (720)	7,074	528	4,104	14,779	1,340
	Fujitsu Computer Products Corporation of the Philippines カメルレイ工場 (フィリピン) (注5.)	磁気ディスク 装置製造設備	0 (283)	2,298	5,480	131	7,909	6,210

(3) 電子デバイス

平成16年3月31日現在

会社名及び事業所名 (所在地)		設備の内容	投下資本 (百万円)					従業員数 (人)
			土地 (面積千㎡)	建物 及び 構築物	機械装置	その他	合計	
提出会 社	三重工場 (三重県桑名郡多度町)	半導体製造設 備	4,327 (307)	11,398	8,949	1,833	26,509	1,018
	岩手工場 (岩手県胆沢郡金ヶ崎町)	半導体製造設 備	2,881 (290)	9,962	12,699	2,795	28,338	1,738
	会津若松工場 (福島県会津若松市)	半導体製造設 備	7,826 (892)	6,350	5,365	1,191	20,733	1,441
	あきる野テクノロジセンター (東京都あきる野市)	半導体研究開 発、製造設備	12,756 (121)	14,436	1,681	1,999	30,717	1,782
国内子 会社	新光電気工業㈱ 高丘工場 (長野県中野市)	半導体パッケ ージ製造設備	2,109 (94)	5,227	5,024	3,487	15,849	1,252

平成16年3月31日現在

会社名及び事業所名 (所在地)	設備の内容	投下資本（百万円）					従業員数 (人)	
		土地 (面積千㎡)	建物 及び 構築物	機械装置	その他	合計		
国内子 会社	富士通日立プラズマディスプレイ(株) 宮崎事業所 (宮崎県東諸県郡国富町)	PDP製造設備	1,048 (197)	5,833	4,527	165	11,575	752
	富士通ディスプレイテクノロジー(株) 米子テクノロジーセンター (鳥取県米子市)	LCD開発製造 設備	1,308 (118)	3,201	3,585	165	8,261	459
	富士通カンタムデバイス(株) 本社 (山梨県中巨摩郡昭和町)	化合物半導体 製造設備	933 (107)	4,970	1,095	548	7,548	843

(4) 共通

平成16年3月31日現在

会社名及び事業所名 (所在地)	設備の内容	投下資本（百万円）					従業員数 (人)	
		土地 (面積千㎡)	建物 及び 構築物	機械装置	その他	合計		
提出会 社	川崎工場 (川崎市中原区)	ソフトウェア、情報システム及び通信システムに関する研究開発設備	3,442 (164)	18,448	895	13,344	36,131	8,642
国内子 会社	(株)富士通研究所 厚木研究所 (神奈川県厚木市) (注6.)	ソフトウェア、情報システム、通信システム及び電子デバイスに関する研究開発設備	0 (19)	3,845	3,259	2,284	9,389	541

- (注) 1. 投下資本は期末帳簿価額によります。ただし、建設仮勘定を除きます。
2. 投下資本の機械装置には、車両及び運搬具を含みます。また、その他とは工具器具及び備品であります。
3. 富士通ソリューションスクエアの土地及び建物の一部は(有)エス・エス・エステートより賃借しているものがあります。
4. Fujitsu Services Holdings PLCの数値は連結決算数値であります。また、建物の一部を賃借しております。
5. Fujitsu Computer Products Corporation of the Philippinesの土地はすべてFujitsu Development Corporation of the Philippinesから賃借しているものがあります。
6. (株)富士通研究所の土地はすべて当社から賃借しているものがあります。
7. 上記のほか、主要なリース資産として以下のものがあります。

会社名及び事業所名 (所在地)		設備の内容	未経過リース料 (百万円)
提出会社	あきる野テクノロジセンター (東京都あきる野市)	最先端半導体開発設備	14,691
国内子会社	富士通日立プラズマディスプレイ(株) 宮崎事業所 (宮崎県東諸県郡国富町)	PDP製造設備	22,823
	富士通カンタムデバイス(株) 本社 (山梨県中巨摩郡昭和町)	化合物半導体製造設備	5,320

3【設備の新設、除却等の計画】

(1) 当社グループ(当社及び連結子会社)の当連結会計年度後1年間の設備投資計画(新設・拡充)は、235,000百万円であり、事業の種類別セグメントごとの内訳は次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称	平成16年3月末計画額 (百万円)	設備等の主な内容・目的
ソフトウェア・サービス	70,000	アウトソーシング関連設備、ネットワークサービス関連設備の更新及び拡充
プラットフォーム	50,000	UNIXサーバ、Linuxサーバ開発設備、HDD開発・製造設備、携帯電話開発・製造設備の更新及び拡充
電子デバイス	90,000	新工場の建設、最先端ロジックIC開発・量産設備、PDP製造設備の更新及び拡充
その他、全社共通	25,000	オーディオ・ナビゲーション機器、移動通信機器及び自動車用電子機器の開発・製造設備
計	235,000	—

- (注) 1. 今後の所要資金235,000百万円は、自己資金により充当する予定であります。
2. 設備投資の計画額は、消費税抜きで表示しております。
3. 経常的な設備の更新のための除・売却を除き、重要な設備の除・売却の計画はありません。
4. 全社(共通)は、一般管理部門及び共通研究費等のセグメントに配賦不能な設備投資額であります。

(2) 重要な設備の拡充の計画は、次のとおりであります。

電子デバイス

事業所名	所在地	設備の内容	投資予定金額 (百万円)	着手及び完了予定	
				着手	完了
提出会社	三重工場(新棟)	三重県桑名郡多度町 最先端半導体量産設備	75,000	平成16年4月	平成17年度